BL-13B/2015G666, AR-NW10A/2015P014

三元系スズ酸化物 Sn2Nb2O7の荷電子帯上端近傍の局在状態の消失 Disappearance of Localized States near the Valence Band Maximum of Ternary Tin Oxide with Pyrochlore Structure, Sn2Nb2O7

相浦義弘^{1,*},小澤健一²,阪東恭子³,間瀬一彦^{4,5}

¹産業技術総合研究所(AIST)電子光技術研究部門,〒305-8568 つくば市梅園 1-1-1

²東京工業大学 理学院, 〒152-8551 東京都目黒区大岡山 2-12-1

³産業技術総合研究所(AIST) ナノ材料研究部門, 〒305-8565 つくば市東 1-1-1

4高エネルギー加速器研究機構(KEK) 放射光科学研究施設, 〒305-0801 つくば市大穂 1-1

5総研大(総合研究大学院大学),〒305-0801 つくば市大穂 1-1

Yoshihiro Aiura,^{1,*} Kenichi Ozawa,² Kyoko Bando,³ and Kazuhiko Mase^{4,5}

¹Electronics and Photonics Research Institute, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Ibaraki 305-8568, Japan

²Department of Chemistry, Tokyo Institute of Technology, Meguro, Tokyo 152-8551, Japan

³Nanomaterials Research Institute, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Ibaraki 305-8565, Japan

⁴Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Tsukuba, Ibaraki 305-0801, Japan

⁵SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies), Tsukuba, Ibaraki 305-0801, Japan

<u>1 はじめに</u>

高性能な p 型電導性酸化物(TCO)の開発は、革新 的な透明電子デバイスの開拓を可能にする[1]。価電 子帯上端(VBM)近傍のバンド分散が大きく、有効質 量が小さくなるような酸化物が、実用的な p型 TCO の有力候補となると期待されている [2]。その有力 候補の1つとして、近年、SnO が着目されている。 SnOの Sn は、形式的に 2 価を取り、5s 軌道に 2 個 の電子が存在する。この Sn 5s²が局在的な O 2p と 強い混成を引き起こし、VBM 近傍に非局在バンド が現れる。欠陥や不純物を含まない SnO は、絶縁体 となるが、実際の SnO では Sn の欠陥により系にホ ールがドープされ p 型半導体特性を示す。しかし、 Sn 欠陥の存在は、同時にホールキャリアの伝導経路 の乱れを引き起こす。この伝導経路の乱れは、ホー ルキャリアの移動度の低下をもたらすとともに、キ ャリア密度と移動度の独立した制御を困難にする。 この問題を取り除くには、ホールキャリアの供給源 と伝導経路を分離することが必要である。

パイロクロア構造を有する Sn₂Nb₂O₇ は、Sn₂O 構 造と Nb₂O₆構造から成り立つ。近年の我々の軟 X 線 放射光を用いた高分解能光電子分光(SXPES) およ び X 線吸収微細構造(XAFS)の研究により、Nb₂O₆構 造の 5 価の Nb⁵⁺の一部が 4 価の Sn⁴⁺と置換すること によりホールキャリアがドープされ、そのキャリア が Sn₂O 伝導経路を移動することにより p 型半導体 として機能することを示した[3]。すなわち、図 1 に 示すように、Sn₂Nb₂O₇ はホールキャリアの供給源と 伝導経路が分離しており、p型 TCO の有力候補であ ると考えられる。しかし、図 2 に示すような理論的 なバンド計算によると、VBM に分散の少ない、す なわち、(局在的な)平坦なバンドが現れることが 示された。このような VBM 近傍の局在バンドの出 現は、ホール移動度の著しい低下をもたらすものと 考えられる。



図1 Sn₂Nb₂O₇の電子構造の模式図。電子密度は Nb₂O₆ 八面体構造内の Nb 4d 軌道および隣接する O(1) 2p 軌 道からの寄与(左側)、および Sn₂O 四面体構造の内 の Sn 5s 軌道および隣接する O(2) 2p 軌道からの寄与 (右側)に分離 [3]。



本研究の目的は、 $Sn_2Nb_2O_7$ の VBM 近傍の電子構 造を SXPES で明らかにするとともに、XAFS により 局所結晶構造の結晶構造と結びつけることにより、 p型 TCO としての可能性を検討することである。

<u>2 実験</u>

<u>2.1 SXPES および XAFS</u>

Sn₂Nb₂O₇の高分解能 SXPES 測定は、高エネルギ 一加速器研究機構 放射光科学研究施設(KEK PF) BL-13 にて行った。清浄表面は、単結晶試料を超高真空 中で破砕することにより得た。XAFS 測定は、KEK PF AR-NW10A にて行った。局所構造における点欠 陥の影響を明らかにするために、単結晶および多結 晶試料の Sn K-edge および Nb K-edge の広域 X 線吸 収微細構造(EXAFS)測定を行った。全ての測定は室 温で行った。

<u>2.2 測定試料</u>

単結晶 Sn₂Nb₂O₇試料は、フローティングゾーン (FZ)法により作製した。X 蛍光分光により Sn/Nb は 0.98、メスバウアー分光により Sn²⁺:Sn⁴⁺=95.5:4.5 であることが示された。加えて、Sn⁴⁺のピーク形状 から、Sn⁴⁺は対称な Nb⁵⁺サイトに位置することが示 唆された。図 3 に示すように、参照試料の SnO₂の Sn3d と O 1s の内殻スペクトルの面積比と Sn₂Nb₂O₇ の面積比を比較することにより、Sn 原子あたり 3.63 個の酸素と見積もった。その結果、測定に用いた単 結晶の Sn₂Nb₂O₇の実組成を

 $Sn^{2+}_{1.79}$ (Nb⁵⁺_{1.92} $Sn^{4+}_{0.08}$) O²⁻_{6.77}





図 3 (a) Sn₂Nb₂O₇および(b) SnO₂の O1s および Sn 3d 内 殻スペクトル [3]。

<u>2.3 電気特性</u>

多結晶 $Sn_2Nb_2O_7$ 試料は固相反応法により作製した。多結晶試料の半導体特性は、焼結条件(温度、雰囲気)により制御できた。ゼーベック定数もまた正($+5.9 \times 10^6$ cm⁻³)となる。ホールキャリアの移動度は 0.19 cm²V⁻¹s⁻¹と見積もった。

単結晶 Sn₂Nb₂O₇ 試料は負のゼーベック係数を示 した。単結晶試料は還元雰囲気中で高温焼結により 作製されるので、n 型電気特性は酸素欠損に由来す るものと推察される。光電子分光によりエネルギー ギャップ中に顕著な状態が現れていないことにより、 酸素欠損により生じる余分な電子は、Sn⁴⁺置換欠陥 および Sn²⁺欠陥により生じる余分なホールによりほ ぼ補償されていると推察される。

2.4 バンド計算

Sn₂Nb₂O₇の電子構造は、FLAPW および GGA 近似 による WINE2k を用いて行った。計算により示され たバンドギャップ (E_G) は 0.9 eV である。実際の光 学スペクトルにより見積もられた E_G (2.3 eV)と比較 して、計算により示された E_G は非常に小さい。実 験結果と比較するために、バンド計算の VBM を PES の VBM と一致させ、バンド計算による伝導帯 の下端 (CBM) をフェルミエネルギーに一致させた。 バンド計算のよる状態密度 (DOS) は、光エネルギ ー100eV の時の全エネルギー分解能 (100 meV) の 半値幅を持つガウス関数で広げた。

3. 結果および考察



図 4 Sn₂Nb₂O₇ および SnO₂ の(a) SXPES スペクトル (左側) および(b) O K-edge NEXAFS スペクトル (右 側)、(b) バンド計算による O(1)の部分状態密度 (PDOS,赤)、O(2)の PDOS (オレンジ)、酸素の PDOS (=PDOS₀₍₁₎+PDOS₀₍₂₎ 黒色)、その拡大図 (inset)、(c)パイロクロア構造の模式図 [3]。

図 4(a)に、Sn₂Nb₂O₇単結晶および参照試料 SnO₂ 単結晶の SXPES スペクトルおよび O K-edge 吸収端 付近 X 線吸収微細構造 (NEXAFS) のスペクトルを 示した。O K-edge NEXAFS により示された伝導体帯 の電子構造は、バンド計算の酸素の部分状態密度と 良く一致している (図 4(b))。実験と計算の顕著な 矛盾点は、「VBM 近傍の局在状態が SXPES で観測 出来なかった」ことである。

VBM 近傍の局在状態の消失の原因は、計算に用 いた「理想的な」結晶構造が「実際の」結晶構造と 食い違うことに由来するものと推察される。このこ とを検証するために、Sn K-edge および Nb K-edge EXAFS により局所的な結晶構造を調べた。図5の赤 線はp型半導体のSn₂Nb₂O₇多結晶試料、黒線は絶縁 体の多結晶試料、青線は n型半導体の多結晶試料、 緑線は n 型半導体の単結晶試料の EXAFS スペクト ルを示す。Nb K-edge EXAFS に示されるように、Nb 周りの O(1)原子(赤色でハッチした第一配位子圏) の局所構造に顕著な差異は示されなかった。一方、 Sn K-edge EXAFS に示されるように、Sn 周りの O(1), O(2)原子の局所構造は電気伝導に敏感に変化するこ とが示された。電気特性は欠陥構造と密接に関連す ることにより[3]、Nb2O6八面体構造は各種欠陥に対 して「堅牢」であるのに対して、Sn₂O四面体構造は 欠陥に対して「脆弱」であることを意味する。更に、 図 5(a)に示すように、~3 Å 近傍の第二配位子圏の スペクトル構造においても大きな差異が示された。 Nb K-edge EXAFS スペクトルの第二配位子圏に変化 が示されないことにより、Sn K-edge EXAFS スペク トルの第二配位子圏の変化は、Sn 周りの局所構造が 大きく変化していることを示唆しているものと考え られる。



<u>4. まとめ</u>

本研究において、以下の2点が明らかになった:

 (1) Sn₂Nb₂O₇の p 型半導体の起源は、Sn²⁺の一部が Sn⁴⁺となり、Nb⁵⁺サイトに位置するような(置換)欠陥が生じ、ホールキャリアを供給する。 この供給されたホールキャリアは、Sn₂O 四面体 構造の伝導経路を伝わり、結晶内を移動し、p 型電気特性を示す(図 6 参照)。一方、Sn²⁺の 欠陥により生じるホールは、O(2)欠陥により生 じる電子により補償されると考えられる[3]。



図 6 Sn₂Nb₂O₇の電荷供給源と伝導経路 [3]。

(2) バンド計算のより示された VBM 近傍の局在状態の消失は、ホールキャリアの伝導経路となる Sn₂O 四面体構造が脆弱で、理想的なパイロクロ ア構造から逸脱していることに由来すると推察 される。

Sn₂O四面体構造の局所構造を明らかにし、実際の 伝導経路の振舞を明らかにすることが、Sn₂Nb₂O₇の 実用的な p型半導体材料の有力候補かどうかの判 断材料となると思われる。

謝辞

Snのメスバウアー分光の測定は、文部科学省ナノ テクノロジープラットフォーム事業(分子・物質合 成)の支援により名古屋工業大学で実施し、解析及 び議論に関しては壬生教授とともに行った結果であ る。ここに感謝いたします。

参考文献

- [1] Z. Wang et al., Adv. Mater. 28, 3831 (2016).
- [2] H. Kawazoe et al., Nature 389, 939 (1997).
- [3] Y. Aiura et al., J. Phys. Chem. C 121, 9480 (2017).

* y.aiura@aist.go.jp